IJ: maker 09/780,433 2878

APR 2 5 2001

日本国特許庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙窓付の豊類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2000年 2月15日

出 願 番 号 Application Number:

特願2000-037045

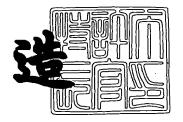
出 願 人 Applicant (s):

キヤノン株式会社

2001年 3月 9日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Patent Office





特2000-037045

【書類名】

特許願

【整理番号】

4116028

【提出日】

平成12年 2月15日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

G02B 26/10

【発明の名称】

光学式エンコーダ

【請求項の数】

4

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区下丸子三丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】

石塚 公

【特許出願人】

【識別番号】

000001007

【氏名又は名称】

キヤノン株式会社

【代表者】

御手洗 冨士夫

【代理人】

【識別番号】

100075948

【弁理士】

【氏名又は名称】

日比谷 征彦

【電話番号】

03-3852-3111

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

013365

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9703876

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光学式エンコーダ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 相対移動する回折格子スケールに可干渉光束を照射して2つの異なる次数の回折光を発生し、円環状に格子パターンを形成した回折格子に前記2つの回折光を略点状に集光して照明し、該個所から発生した回折光を前記回折格子スケールに再照射して再び回折し、前記それぞれの回折光同士を重ね合わせて干渉させた光束を受光素子に導き、前記回折格子スケールの移動に伴う周期信号を出力することを特徴とする光学式エンコーダ。

【請求項2】 前記円環状格子は反射型の回折格子とした請求項1に記載の 光学式エンコーダ。

【請求項3】 相対移動する回折格子スケールに収束可干渉光束を照射して2つの異なる次数の回折光を発生し、円環状に格子パターンを形成した回折格子に前記2つの回折光を略点状に集光して回折し、前記回折格子スケールに再照射して再び回折し、それぞれの回折光同士を重ね合わせて干渉させた光束を受光素子に導き、前記回折格子スケールの移動に伴う周期信号を出力することを特徴とする光学式エンコーダ。

【請求項4】 回折レンズに可干渉光束を照射し、相対移動する回折格子スケールに集光して2つの異なる次数の回折光を発生し、円環状に格子パターンを形成した回折格子に前記2つの回折光を略点状に集光して回折し、前記回折格子スケールに再照射して再び回折し、それぞれの回折光同士を重ね合わせて干渉させた光束を受光素子に導き、前記回折格子スケールの移動に伴う周期信号を出力することを特徴とする光学式エンコーダ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、産業用計測機械等において、位置や角度情報を検出するための円環状回折格子による反射機構を有する光学式エンコーダに関するものである。

[0002]

【従来の技術】

従来、光の回折干渉現象を応用して物体の位置や速度の変動を検出する格子干渉方式エンコーダが開発製造されている。特に、ミクロンオーダの微細スケールを採用し、このスケールで回折した2つの光束を取り出して干渉させることによって、幾何光学式エンコーダよりもはるかに高分解能のエンコーダが得られている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】

このエンコーダは2つの回折光の波面を合成して干渉パターンを生成する構成を採用しているが、干渉光学系であることから各光学素子の加工や配置精度が非常に厳しいのが現状である。特に、スケール部と検出ヘッド部が分離した組込式のエンコーダの場合には、ユーザがスケールと検出ヘッドをモータやステージ等に装着しなければならないために、その作業の困難さが問題となっている。

[0004]

本発明にお目的は、良好なSN比が得られる光学式エンコーダの提供を目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するための本発明に係る光学式エンコーダは、相対移動する回 折格子スケールに可干渉光束を照射して2つの異なる次数の回折光を発生し、円 環状に格子パターンを形成した回折格子に前記2つの回折光を略点状に集光して 照明し、該個所から発生した回折光を前記回折格子スケールに再照射して再び回 折し、前記それぞれの回折光同士を重ね合わせて干渉させた光束を受光素子に導 き、前記回折格子スケールの移動に伴う周期信号を出力することを特徴とする。

[0006]

また、本発明に係る光学式エンコーダは、相対移動する回折格子スケールに収 東可干渉光束を照射して2つの異なる次数の回折光を発生し、円環状に格子パタ ーンを形成した回折格子に前記2つの回折光を略点状に集光して回折し、前記回 折格子スケールに再照射して再び回折し、それぞれの回折光同士を重ね合わせて 干渉させた光束を受光素子に導き、前記回折格子スケールの移動に伴う周期信号 を検出して電気信号として出力することを特徴とする。

[0007]

本発明に係る光学式エンコーダは、回折レンズに可干渉光東を照射し、相対移動する回折格子スケールに集光して2つの異なる次数の回折光を発生し、円環状に格子パターンを記録した回折格子に前記2つの回折光を略点状に集光して回折し、前記回折格子スケールに再照射して再び回折し、それぞれの回折光同士を重ね合わせて干渉させた光東を受光素子に導き、前記回折格子スケールの移動に伴う周期信号を検出して電気信号として出力することを特徴とする。

[0008]

【発明の実施の形態】

本発明の実施例を説明する前に、前提となるエンコーダについて説明する。

図15は円環状反射光学素子を利用したリニアエンコーダの構成図、図16は ロータリエンコーダの構成図を示す。半導体レーザー光源1から射出した光束L は、コリメータレンズ2、ビームスプリッタ3、円環状反射格子4の中央部を透 過して回折格子スケール4に照射され、回折格子スケール5からの反射回折光L +、Lーはそれぞれ円環状反射格子4上に照射される。ここで、回折格子スケール5上の格子ピッチをP1とすると、円環状反射格子4はピッチP2=P1/2の関係に設定されている。

[0009]

円環状反射格子4は局所的に見ると格子ピッチP2の回折格子として作用し、回折格子スケール5を射出した光束に対してほぼ元の方位へ回折し、回折格子スケール5の略同一位置に向けて照射されて再び回折し、それらの光束がそれぞれ重ね合わされてビームスプリッタ3まで戻される。この光束はそれぞれビームスプリッタ3において半導体レーザー光源1と異なる方向に取り出され、干渉光束として受光素子6により検出される。なお、±1次回折光を使用した場合には、干渉の明暗周期は回折格子スケール5の1ピッチ分の移動に対して4周期である

[0010]

このようなエンコーダにおいては、一般的に半導体レーザー光源1の波長が変動すると回折角が変化して光路がずれると共に、干渉させる2光束間の角度が変って干渉状態に変化が生ずる。また、スケール部と検出ヘッドのアライメントが相対的にずれても同様に光路がずれてしまう。しかし、円環状反射格子4による反射光学素子を使用することによって、回折角がずれても元の角度で進行するために、再回折光の進路に変化が生せず、非常に安定した計測を行うことができるように考案されている。

[0011]

ここで上述の例においては、実際に回折格子スケール5に照射する光束は有限の大きさを有するために、例えば格子ピッチが2.8μmの回折格子スケール5を使用して、この回折格子スケール5と円環状反射格子4との距離を10mmに設定した場合の光束追跡を行うと、図17に示すように円環状反射格子4に特有の波面ひずみが加わって長楕円状の波面となり、受光素子6において受光する際に損失が生ずることも想定され得る。更に、半径が9.2mm、1周の本数が20250本の放射状格子に直径1mmの光束を照射した場合の光束追跡を行うと、図18に示すように円環状反射格子4特有の波面ひずみに更に放射状格子特有の波面ひずみが加わり、±1次回折光を合波する際に互いの波面が歪むことも想定し得る。本発明は上述の点を考慮して発案されたものである。

[0012]

次に、本発明を図1~図14に図示の実施例に基づいて詳細に説明する。

図1は第1の実施例のロータリエンコーダの構成図を示す。半導体レーザー光源10からの光束の光路上に、コリメータレンズ11、ビームスプリッタ12、レンズ13、円環状反射格子14、回折格子スケール15が配列されており、ビームスプリッタ12の反射方向に受光素子16が配置されている。ここで、回折格子スケール15上の格子ピッチをP1とすると、円環状反射格子14はピッチP2=P1/2の関係に設定されている。

[0013]

このような構成により、半導体レーザー光源10から射出した光束Lは、コリ

メータレンズ11により略平行光束となり、ビームスプリッタ12、レンズ13、円環状反射格子14の中央部を透過して、回折格子スケール15に集光照射され、回折格子スケール15からの反射回折光L+、L-はそれぞれ円環状反射格子14上に略点状に照射される。なお、回折格子スケール15として図1のように放射状回折格子スケールを使用した場合には、放射状格子特有の収差によって完全には点状集光とはならない。また、リニア回折格子スケールを使用した場合でもレーザー光のビームウエストサイズ以下にはならないが、これらは微小量なために無視することができる。

[0014]

円環状反射格子14は局所的に見ると、格子ピッチP2のリニア回折格子として作用し、回折格子スケール15の集光照明領域から射出する光束に対して、円環状反射格子14に略点状に入射した光束は反転して元の進路へ回折され、回折格子スケール15に向けて照射されて再び回折し、それらの光束がそれぞれ重ね合わされてビームスプリッタ12まで戻される。この光束はそれぞれビームスプリッタ12によって半導体レーザー光源10と異なる方向へ取り出され、干渉光束として受光素子16で検出される。なお、±1次回折光を使用した場合には、干渉の明暗周期は回折格子スケール15の2ピッチ分の移動につき4周期であり、図2、図3に示すように受光素子16上において略円形の光束が得られる。

[0015]

[0016]

図5は回折格子スケール15の放射格子ディスクの位置を $\Delta x = 0$.5 mmだけずらした場合の光路ずれの説明図である。検出ヘッド部と回折格子スケール15のギャップが小さくなっても、円環状反射格子14で回折されることで、回折

格子スケール15による再回折位置及び射出光束の状態は変らず、干渉状態は安 定している。

[0017]

図6、図7は放射格子ディスクに対して検出ヘッド部を接線方向にΔy=0.5mmだけずらした場合の光束の計算結果の説明図である。この場合は、放射格子ディスクの偏心が0.5mmの場合と等価であり、またリニア格子を使用した場合のスケール配置におけるアジマス誤差と等価である。照射位置がずれても円環状反射格子14の作用により元の光路に回折されるために、回折格子スケール15による再回折位置及び射出光束の状態は変ることはない。図6、図7はそれぞれ±1次回折光の光路を示しており、受光素子16上では上下に多少ずれているが、互いに略平行光束であり干渉状態は安定している。なお、この0.5mmのずれはあくまで計算結果を分かり易くするための量であり、実際のエンコーダではずれ量はもっと少ない。

[0018]

図8、図9は回折格子スケール15と検出ヘッド部の設置角度を、格子配列方位を軸にしてチルト誤差 Δ 0 Z=0.5度だけ与えた場合の光路ずれの説明図である。 \pm 1次回折光の光路をそれぞれ読み取ると、チルト誤差が多少加わっても、回折格子スケール15による再回折位置及び射出光束の状態において、 \pm 1次回折光の光束間に差は生じないので干渉状態は安定している。なお、図8、図9では、受光素子16上への入射光束が受光素子16の面からずれているが、0.5mmのずれは計算結果を分かり易くするための量であり、実際のエンコーダではずれ量はもっと少ない。

[0019]

図10、図11は回折格子スケール15と検出ヘッド部の設置角度を、格子配列方位を軸にしてチルト誤差 $\Delta\theta$ y = 0.5 度だけ与えた場合の光路ずれの説明図である。この場合も、 \pm 1次回折光の光路をそれぞれ読み取ると、チルト誤差が多少加わっても回折格子スケール15による再回折位置及び射出光束の状態において、 \pm 1次回折光の光束間に差は生じないので干渉状態は安定しており、受光素子16の入射位置自体もほぼずれることはない。

[0020]

このように、反射型で円環状の回折格子14とこの光学素子への点状の照射を 組み合わせることによって、小型性かつ高分解能で、取付け誤差に寛容な性能及 び安定した干渉信号の検出を両立させることができる。

[0021]

図12は第2の実施例の斜視図を示し、位相差信号を発生するように偏光素子を配置して2相信号検出にしたものである。偏光素子として偏光板を使用し、またリニア回折レンズを使用したリニアエンコーダであり、偏光素子として1/4 波長板を使用し、放射状回折レンズを使用したロータリエンコーダも可能である

[0022]

可干渉光源である半導体レーザー光源10の光路上に、コリメータレンズ11、非偏光ビームスプリッタ12、レンズ13、円環状反射格子14、偏光方位を互いに90度ずらした2個の偏光板20S、20P、回折格子スケール15が配列されている。非偏光ビームスプリッタ12の反射方向には1/4波長板21、非偏光ビームスプリッタ22が配列され、非偏光ビームスプリッタ22の反射方向に偏光板23a、受光素子16aが配置され、透過方向に偏光板23b、受光素子16bが配置されている。

[0023]

このような構成により、半導体レーザー光源10からの光束はコリメータレンズ11、非偏光ビームスプリッタ12を透過した後に、レンズ13、円環状反射格子14の中央部を介して回折格子スケール15に略垂直に照射される。先ず、回折格子スケール15から反射された+1次回折光は回折角θで射出し、円環状反射格子14により元の光路に回折反射され、更に回折格子スケール15により+1次回折されて非偏光ビームスプリッタ12まで戻される。

[0024]

一方の-1次回折光は回折角θで反対方向に射出し、円環状反射格子14により元の光路に回折反射され、更に回折格子スケール15により-1次回折されて 非偏光ビームスプリッタ12まで戻される。ここで、半導体レーザー光源10か ら回折格子スケール15に照射された光東は、垂直及び水平方向の偏光成分を含んでおり、非偏光ビームスプリッタ12に伝播される±1次回折光は、互いに偏光方位が90度ずれて波面が重なり合っている。ただし、明暗光東にはなっていない。

[0025]

この結果、非偏光ビームスプリッタ12により反射された両光束は1/4波長板21を透過して、2光束間の位相差に基づいて偏光方位が変化する直線偏光光束に変換され、後段の非偏光ビームスプリッタ22により2分割され、それぞれが偏光板23a、23bによって特定の偏光方位のみが抽出されて明暗信号が得られる。これらそれぞれの明暗信号の位相(タイミング)は、偏光板23a、23bの偏光方位のずれで与えられる。即ち、偏光板23aと偏光板23bの偏光方位を互いに45度ずらすことによって、明暗信号の位相差は90度に設定される

[0026]

図13は第3の実施例の斜視図を示し、収束光束を照射する光学手段としてコリメータレンズ11を使用して直接収束光にしたものである。なお、図は非常に 緩やかな収束光となっている。

[0027]

更に、図14は第4の実施例の構成図を示し、円環状反射格子14の中央部(透過窓部)に回折レンズ25が一体的に形成されてある。回折レンズ25は中心 付近の格子ピッチと周辺部の格子ピッチが連続的に変化してパターンニングして あり、凸レンズの作用を有している。

[0028]

また、上述の実施例においては、次の項目に関して部分変更の置き換えが可能 である。

[0029]

(a)回折格子スケール15及び放射状回折格子又は円環状反射格子14において、±1次回折光以外の回折次数の回折光を使用する。

[0030]

(b)偏光板20S、20P、23a、23bをこれと同等な機能を有する他の素子である偏光膜付きプリズムや微細格子パターンとする。

[0031]

(c)位相差板即ち1/4波長板21や1/8波長板を水晶等の結晶光学素子と同等な機能を有する微細構造パターンや他の異方性材料とする。

[0032]

(d)位相差信号を2相以上として位相差を90度以外に設定し、更に偏光素子 や位相差板の配置を一部変更して同等な効果を得る。

[0033]

(e)回折格子スケール15に投光する光束と再回折された光束を、受光素子16に導くために非偏光ビームスプリッタ12、22を使用しているが、回折格子等の他のビーム分割合成手段を使用したり、往路と復路の光路を空間的にずらすことにより分離したり、更に一方の光束のみを選択反射して受光素子16の側に導いてもよい。

[0034]

(f)コリメータレンズ11、非偏光ビームスプリッタ12、レンズ13、円環 状反射格子14の配列順序を変えたりして、他の光学配置を採用して回折格子ス ケール15上に線状に集光する関係を満足させる。

[0035]

なお、以上の各実施例では円環状反射格子としては、例えばガラスエッチング 等により加工されたガラス板の裏面に反射膜を蒸着した素子が利用できるので、 耐環境性が良好である。

[0036]

【発明の効果】

以上説明したように本発明に係る光学式エンコーダは、回折格子スケール又は 円環状回折格子への照射状態を最適化することによって、次に列挙する効果が得 られる。

[0037]

(1)回折光同士の干渉波面が相互に一致し易くなり、フラットな明暗パター

ンが得られ、SN比の良好な安定したエンコーダ信号を得ることができる。

[0038]

(2) 円環状反射格子が例えば平面状の光学素子でよいために、配置空間が複雑にならず小型化に好適である。

[0039]

(3) 光源の波長変動に対して補正が働くので干渉信号が安定する。

[0040]

(4) アライメント誤差に対して補正が働くので、回折格子スケールと検出へ ッドを分離したエンコーダでも取り付けが比較的容易になる。

[0041]

(5) 再帰光学素子が小型でかつ部品点数が少ないために、光束照射手段に更に偏向手段を付加することよって、回折格子スケールへの照射方法や向きに自由度が高くなり、広範な適用姿勢が得られる。

[0042]

(6) 再回折した回折光がそれ程広がらずに、受光素子に導かれるようにできるために、損失が少なくSN比の良好な検出を行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

第1の実施例のエンコーダの構成図である。

【図2】

光束追跡結果の説明図である。

【図3】

光束追跡結果の説明図である。

【図4】

光束波長変化の影響の説明図である。

【図5】

スケールと検出ヘッドのギャップ変化の影響の説明図である。

【図6】

スケールと検出ヘッドのアジマス角度変化の影響の説明図である。

【図7】

スケールと検出ヘッドのアジマス角度変化の影響の説明図である。

【図8】

スケールと検出ヘッドのチルト角度変化の影響の説明図である。

【図9】

スケールと検出ヘッドのチルト角度変化の影響の説明図である。

【図10】

スケールと検出ヘッドのチルト角度変化の影響の説明図である。

【図11】

スケールと検出ヘッドのチルト角度変化の影響の説明図である。

【図12】

第2の実施例のエンコーダの構成図である。

【図13】

第3の実施例のエンコーダの構成図である。

【図14】

第4の実施例のエンコーダの構成図である。

【図15】

従来例のリニアエンコーダの構成図である。

【図16】

従来例のロータリエンコーダの構成図である。

【図17】

光束追跡結果の説明図である。

【図18】

光束追跡結果の説明図である。

【符号の説明】

- 10 半導体レーザー光源
- 11 コリメータレンズ
- 12、22 非偏光ビームスプリッタ
- 13 レンズ

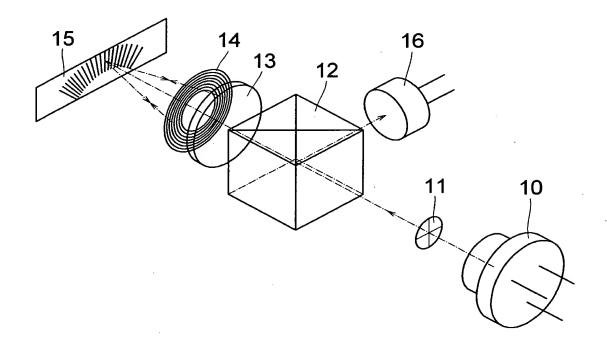
特2000-037045

- 14、14' 円環状反射格子
- 15 放射回折格子スケール
- 16、16a、16b 受光素子
- 20S、20P、23a、23b 偏光板
- 21 1/4波長板
- 25 リニア回折レンズ

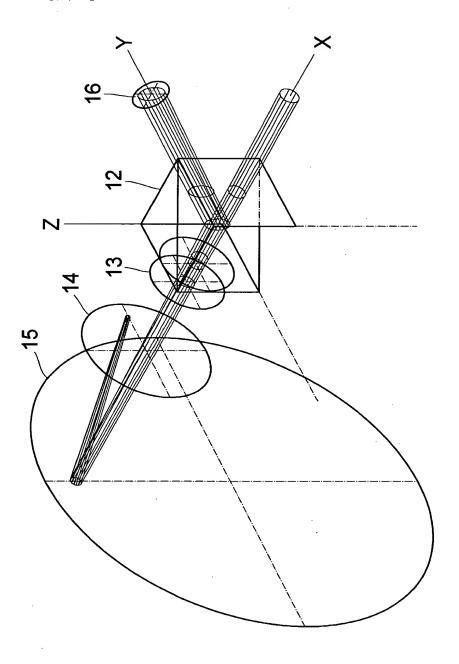
【書類名】

図面

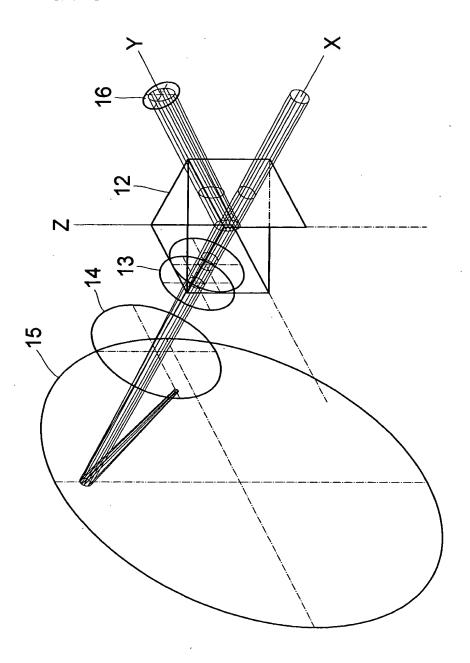
《図1】



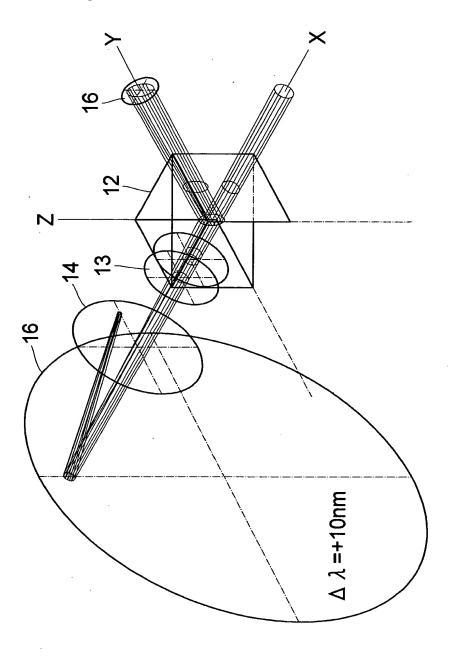
【図2】



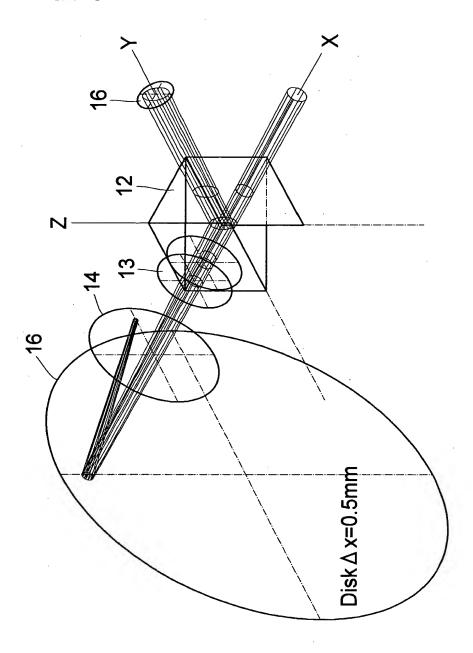
【図3】



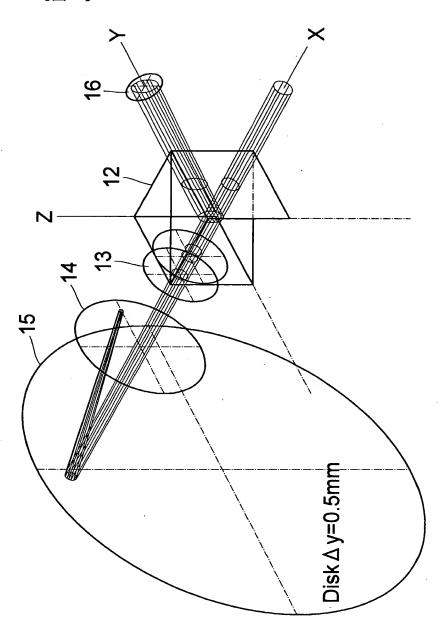
【図4】



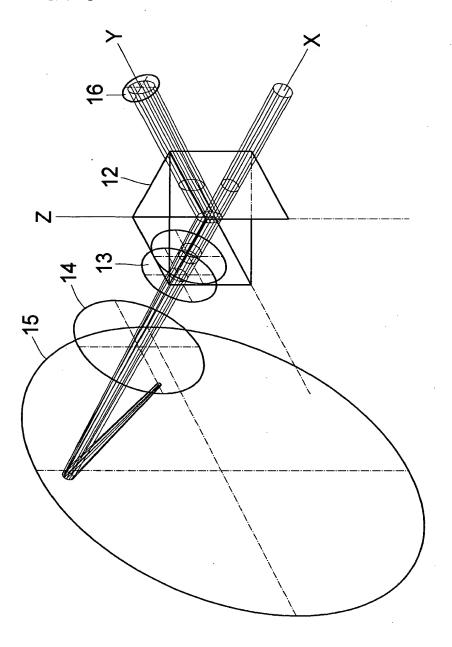
【図5】



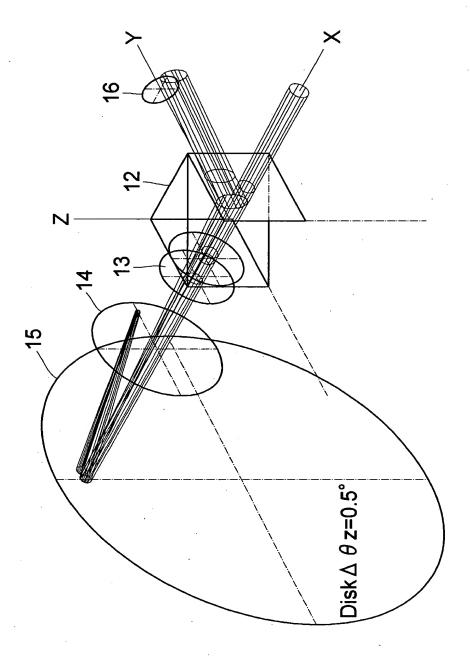
【図6】



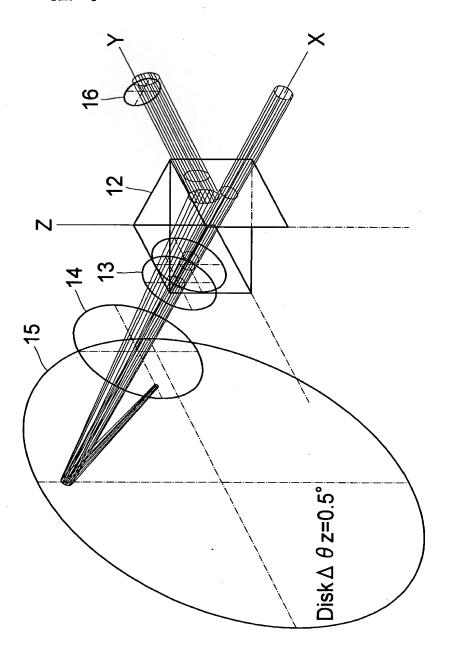
【図7】



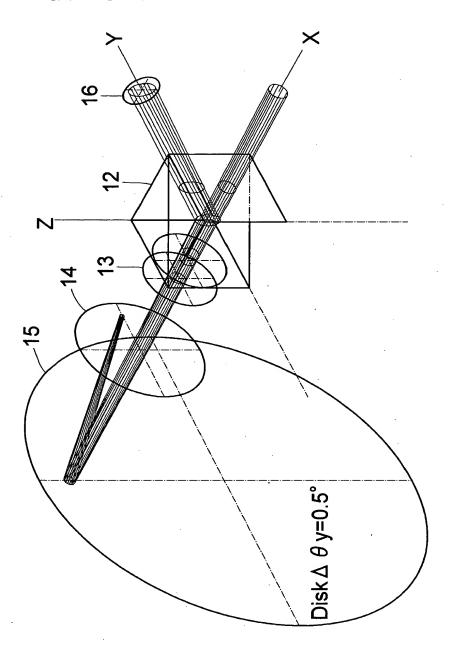
【図8】



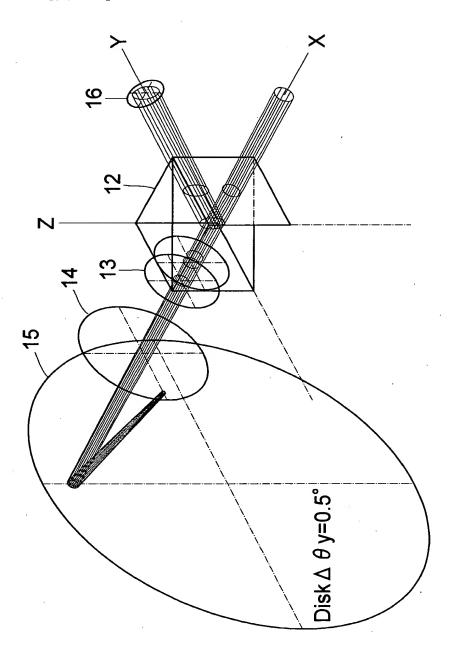
【図9】



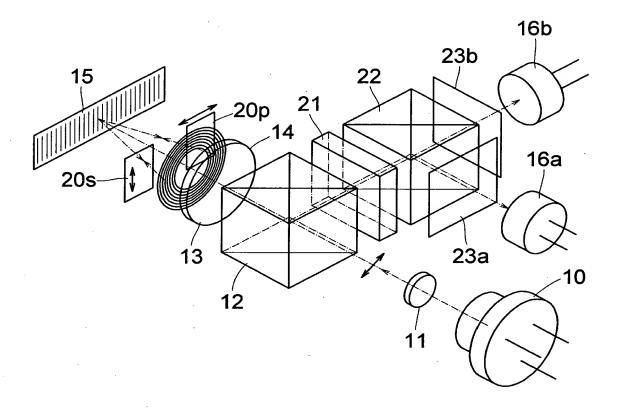
【図10】



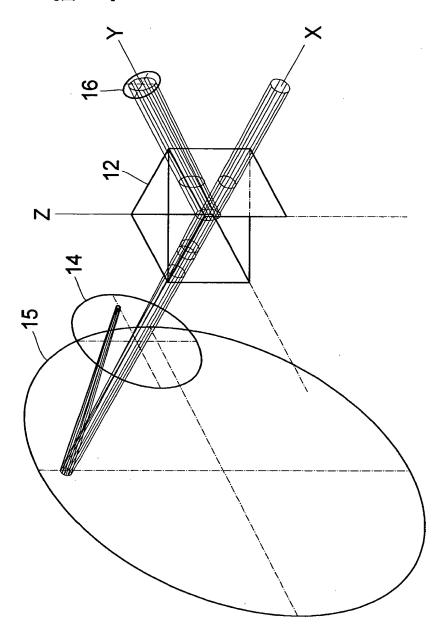
【図11】



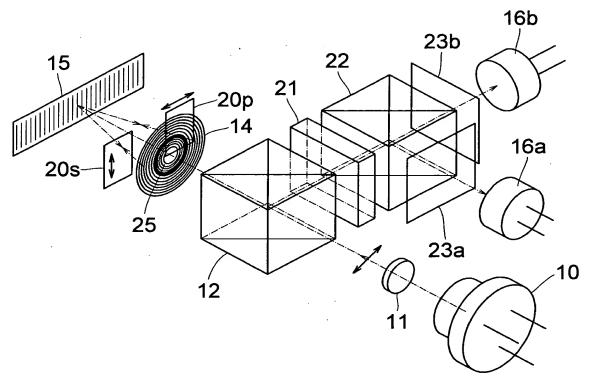
【図12】



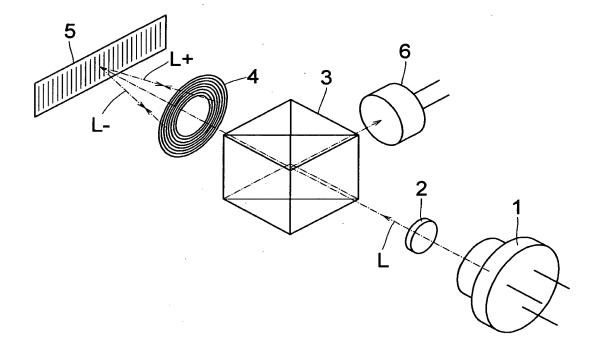
【図13】



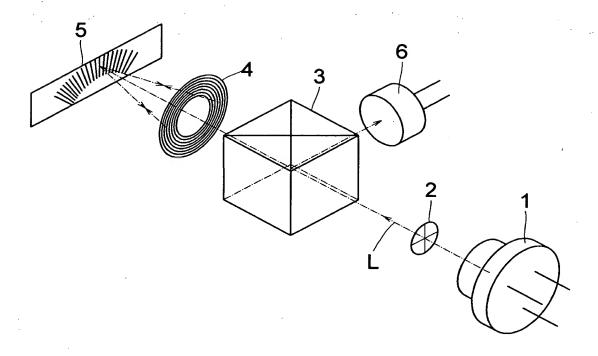
【図14】



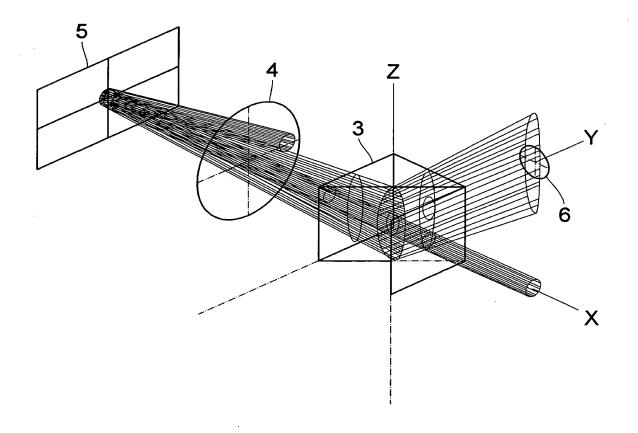
【図15】



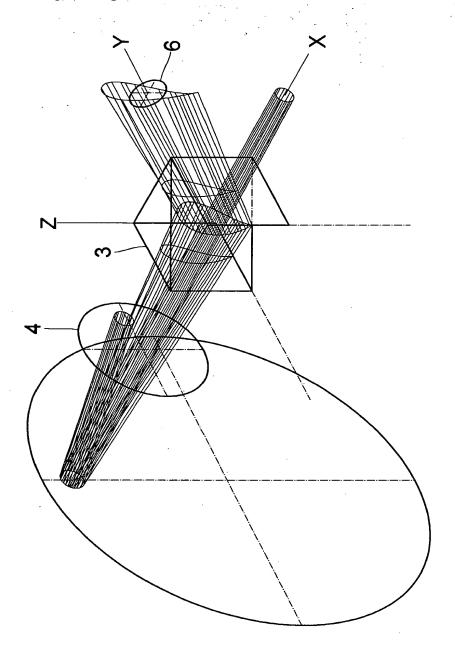
【図16】



【図17】



【図18】



特2000-037045

【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 回折格子スケール又は放射状格子への照射状態を最適化することによって安定した光束検出を行う。

【解決手段】 半導体レーザー光束10からの光束Lは、コリメータレンズ11、非偏光ビームスプリッタ12、レンズ13を介して回折格子スケール15に略垂直に照射され、回折格子スケール15から反射された±1次回折光は互いに反対側に回折角ので射出して円環状反射格子14により元の光路に回折され、更に±1次回折されて非偏光ビームスプリッタ12まで戻される。非偏光ビームスプリッタ12により反射された両光束は1/4波長板21を透過し、2光束間の位相差に基づいて偏光方位が変化する直線偏光光束に変換され、非偏光ビームスプリッタ22により2分割され、それぞれが偏光板23a、23 bにより特定の偏光方位のみが抽出されることでそれぞれ受光素子16a、16 b に明暗信号が受信される。

【選択図】 図12

出願 人履 歴情報

識別番号

[000001007]

1. 変更年月日

1990年 8月30日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

氏 名

キヤノン株式会社